# ساخت و بررسی خواص غشای کلوئیدی تیتانیای نانوساختار

على عالم \* و حسين سرپولكى

دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکاهٔ مهندسی مواد

تاريخ ثبت اوليه:١٣٨٤/٨/١٨، تاريخ دريافت نسخهٔ اصلاحشده:١٣٨٤/١٢/١٩، تاريخ پذيرش قطعى:١٣٨٧/٥/٢۴

چکیده در این مقاله عوامل مؤثر بر ساخت و خواص غشای تیتانیایی برروی زیرپایهٔ آلومینا بررسی شده است. ابتدا زیرپایه با پرس تکمحور ساخته و سپس سل کلوئیدی تیتانیا آماده شد. از افزودنی های پلی وینیل الکل (PVA) و هیدروکسی پروپیل سلولز (HPC) برای داشتن غشایی بدون ترک، در مقادیر خاصی در ساخت سل کلوئیدی تیتانیا استفاده شد. سپس، لایه نشانی تیتانیا برروی زیرپایهٔ آلومینا به روش غوطه وری انجام شد و لایهٔ تهیه شده، خشک و کلسینه شد. میانگین اندازهٔ ذرات موجود در سل کلوئیدی باستفادهاز تکنیک تفرق پرتو لیزر، برابر ۵۵/۹۳ اندازه گیری شد. به منظور ارزیابی دمای استحالهٔ فازی در تیتانیا از پراش اشعهٔ ایکس استفاده شد. تکنیک توزین حرارتی برای تعیین دمای خروج افزودنی های آلی و مواد فرار لایه به کار رفت. این نتایج به همراه نتایج آنالیز فازی پراش اشعهٔ ایکس استفاده شد. تکنیک توزین حرارتی برای تعیین دمای خروج افزودنی های آلی و مواد فرار لایه به کار رفت. این نتایج به همراه نتایج آنالیز فازی پراش اشعهٔ ایکس استفاده شد. تکنیک توزین حرارتی برای منبر دمای خروج افزودنی های آلی و مواد فرار لایه به کار رفت. این نتایج به همراه نتایج آنالیز فازی نیانیا، به انتخاب دمای بهینهٔ کلسیناسیون لایه (۴۵۰ مای منجر شد. بررسی ریزساختاری غشایی به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی، نشان می ده خامات غشا برابر ۵۰۰ نانومتر است. بررسی های بیشتر در این ضخامت نشانده ندهٔ غشایی بدون ترک با ریزساختاری همگن است. این امر نشانده ندهٔ بهینه بودن شرایط

كلمات كليدى تيتانيا، غشا، خاصيت فوتوكاتاليستي.

## Preparation and Characterization of Nanostructure Titania Colloidal Membranes

#### A. Alem<sup>\*</sup> and H. Sarpoolaky

Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering, Iran University of Science and Technology

**Abstract** In this investigation a nanostructure titania membrane on an alumina support was prepared. The support was made via a single axis press. The titania colloidal sol was then prepared. To have a crack free titania membrane, PVA and HPC additives were included in the sol in specific amounts. The support was dipped in the sol and the layer was dried and calcined in a proper manner. The average particle size of the titania sol was measured to be 55.6 nm. X ray diffraction technique was utilized to determine the titania phase transformation temperature. The burn out temperature of the volatile materials and the organic additives were determined via the TGA technique. Utilizing the XRD and TGA techniques the optimum calcinations temperature was determined to be 450°C. Microstructure and the presence of any possible crack or defect were examined using Scanning Electron Microscopy. The final product was a crack-free titania membrane with no defect. Therefore, it can be concluded that the membrane preparation procedure is optimum.

Keywords Titania, Membrane, Photocatalytic Properties.

نشانی: تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکدهٔ فنی مهندسی مواد.

تلفن: ۰۲۱\_۸۸۷۱۳۱۰۰، پیامنگار: gmail.com وgmail.com

تعهدهدار مكاتبات

### ۱\_ مقدمه

غشا یک سد نیمه تراواست که به یک یا چندگونه یا جزء از مخلوط های گازی یا مایع اجازهٔ عبور می دهد. غشاهای آلی (پلیمری) و غیرآلی (سرامیکی) مدت هاست که به طور گسترده ای برای تصفیهٔ آب ها و پساب ها در کشورهای صنعتی به کار می رود. غشاها براساس نیروی محرکهٔ فشاری و اندازهٔ حفره به ترتیب شامل اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون و میکروفیلتراسیون هستند. در ترتیب ذکرشده اندازهٔ حفرهٔ غشا افزایش می یابد؛ یعنی کوچک ترین حفره ها در غشای اسمز معکوس وجود دارد و بزرگ ترین حفره ها در غشای میکروفیلتراسیون [۲،۱].

غشاهای سرامیکی به دلیل مزایای متعدد نسبت به انواع پلیمری برتری دارند این مزایا شامل پایداری حرارتی، شیمیایی و مکانیکی بالاتر آنهاست. اکسیدهای مهم برای ساخت غشاهای سرامیکی شامل Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>، CrO<sub>2</sub> و SiO هستند. در این میان، به غشاهای تیتانیایی توجه کردهاند که دلیل آن شار یا فلاکس بالای فاز مایع، نیمه هادی بودن، مقاومت شیمیایی بسیار بالای تیتانیا در محیط های آبی و خاصیت فوتوکاتالیستی مطلوب آن درمقایسه باقیه است [۳].

تیتانیا یک نیمه هادی از نوع n و عنوان یکی از مهم ترین مواد نانو نیمه هادی محسوب می شود که در دو دههٔ گذشته درنقش یک کاتالیست مطلوب برای تصفیهٔ آبوهوا به کار رفته است. درحال حاضر روش های تهیهٔ TiO شامل رسوب از فاز بخار، سل ژل، الکتروشیمی، تبخیر و کندوپاش است. در این میان مهم ترین و معمول ترین روش برای سنتز پوشش TiO، تکنیک سل ژل است. فرآیند سل ژل دو روش مختلف دارد که یکی از این دو، روش سل ژل کلوئیدی است که امکان ساخت مواد نانوساختار و مزوپور (اندازهٔ حفره بین ۲ تا ۵۰، ۵۱) را فراهم می سازد. در روش سل ژل کلوئیدی، می توان با به کارگیری

آلکوکسیدهای فلزی، سوسپانسیون هایی برپایه آب ساخت تا محصول نهایی با خواص مطلوب تهیه شود [۵،٤]. تهیهٔ تیتانیا به روش سل ژل هم به صورت نانوذرات و هم به صورت لایه امکان پذیر است که هر محصول مزایا و معایب خود را دارد. از مهم ترین مشکلات نانوذرات عدم پایداری آنها در دراز مدت است که باعث بروز مشکلاتی می شود. لازم به ذکر است که برخلاف نانوذرات، لایه های نازک تولیدشده به روش سل ژل، از پایداری بالایی بر خوردارند. از مهم ترین مشکلات لایه های نشانده شده برروی زیرپایه ها نیز می توان به کاهش سطح مخصوص آنها اشاره کرد [۲-۸].

## ۲\_ نحوهٔ انجام آزمایش

#### ۱\_۲\_ ساخت غشا

#### ۲\_۱\_۱\_ ساخت زیرپایه

ساخت زیرپایه ها با پرس پودر آلومینای گرانوله KMS-92 محصول شرکت مارتینزورک<sup>۱</sup> انجام گرفت. مشخصات این پودر در جدول ۱ آمده است. نمونه ها تحت فشار ۳۱MPa پرس شدند. قطر نمونه ها درحدود ۱/۵cm و ضخامت آنها درحدود بود. زیرپایه های خام در محدودهٔ دمایی ۲°۱۱۰۰ تا ۲°۰۴۰ به مدت ۱ ساعت زینتر شدند.

#### ٢\_١\_٢\_ ساخت لاية تيتانيا

مواد اولیهٔ مصرفی در ساخت سل کلوئیدی تیتانیا عبارتاند از: تترا ایزوپروپیل اورتوتیتانات (Merck ،۸۲۱۸۹۵) درنقش آلکوکسید فلزی تیتانیا، ایزوپروپانول (Merck ،۱۰۹۶۳۴) درنقش حلال، هیدروکسی پروپیل سلولز<sup>۲</sup> (Aldrich ،۴۳۵۰۰۷) و

<sup>1.</sup> Martinswerk.

<sup>2.</sup> HPC.

**جدول ۱.** مشخصات پودر گرانوله KMS-92.

مواد تشکیل دهنده	درصد
$Al_2O_3$	٩٢
CaO	۲/۵
SiO <sub>2</sub>	٣/۶
MgO	١/۵

پلی وینیل الکل<sup>۳</sup> (۸۲۱۰۳۸، Merck)، درنقش افزودنی آلی، اسید نیتریک (Merck ،۱۰۰۴۴۳)، درنقش ممانعت کننده و آب مقطر.

ابتدا محلول آلکوکسید فلزی در ایزوپروپانول با غلظت ۴/۰ مول بر دسی مترمکعب تهیه و ۱۰ دقیقه همزده شد. سپس محلول دوم شامل آب در ایزوپروپانول با غلظت ۴/۵ مول بر دسی مترمکعب تهیه شد. سپس با افزودن محلول اول (حاوی آلکوکسید) به محلول دوم (حاوی آب) و انجام فرآیند. هیدرولیز، سوسپانسیون 4(Ti(OH تهیه شد. رسوب موجود در سوسپانسیون ابتدا با، کاغذ صافی جمع آوری و سپس با آب مقطر شست و شو شد. سپس رسوب Ti(OH)4 حاصل با آب مقطر برای رسیدن به سل با غلظت ۰/۱ مول بر دسی متر مکعب رقیق شد. پس از آن سل توسط اسید نیتریک با نسبت مولی H⁺/Ti=۰/۵ لخته زدایی شد و برای تکمیل فرآیند لخته زدایی ۷۵ دقیقه در دمای C°۴۵ تا C°۰۵ درحین به هم خوردن حرارت داده شد. پس از قراردادن سل به مدت ۲ ساعت در حمام اولتراسونیک، افزودنی های هیدروکسی پروپیل سلولز و پلی وینیل الكل (به ترتيب با غلظت هاى ٣٥gr/100cm<sup>3</sup> و ٠/٣٥gr/100cm<sup>3</sup>) به ترتیب با نسبت های یک سوم و دو سوم حجم سل، به آن افزوده شد. درنهایت نیز سل بهمدت ۲۴ ساعت در دمای محیط

پیرسازی شد.

پس از تهیهٔ سل مناسب، عملیات پوشش دهی به روش غوطه وری برروی زیرپایه ها انجام شد. به این منظور تنها یک طرف زیرپایه با سل تماس داده شد و پس از طی زمان موردنظر، نمونه از سل خارج شد. پس از پوشش دهی، لایه به همراه زیرپایه به مدت ۲۴ ساعت در دمای محیط پیرسازی شد. فرآیند خشک کردن لایه به مدت ۱ ساعت در دمای ۲°۳۰ و ۳ ساعت در دمای ۲°۲۰ انجام شد و سپس لایه ها با نرخ ۲۰۱۲° در دمای ۲°۴۰ به مدت ۱ ساعت زینتر شدند. لازم به ذکر است که در این فرآیند از کوره آذر ۱۵۰۰ استفاده شد و کل سیکل گرمایش، ۴۶ ساعت طول کشید.

### ۲\_۲\_ تعیین خواص

۲\_۲\_۱ تعیین خواص زیرپایهٔ آلومینا

اندازه گیری تخلخل زیرپایه های زینترشده در دماهای مختلف به روش ارشمیدس و طبق استاندارد ASTM 373-88 انجام گرفت. استحکام خمشی زیرپایه ها نیز با دستگاه SANTAM STM-400 انجام شد. برای اندازه گیری استحکام مکانیکی، نمونه های مکعب مستطیلی با ابعاد تقریبی ۵۳mx ۱۴mm تهیه شد و آزمایش به روش سه نقطه ای انجام شد. لازم به ذکر است که در تعیین دانسیته و استحکام خمشی زیرپایه ها هر آزمایش سه بار انجام شد و مقادیر میانگین به عنوان نتیجه ارائه شدند.

#### ۲\_۲\_۲ تعیین خواص لایهٔ کلوئیدی تیتانیا

اندازهٔ ذرات سل کلوئیدی با تکنیک تفرق پرتو لیزر (ZetaSizer, Malvern UK, 3000HSA) تعیین شد. رفتار حرارتی تیتانیا با آنالیز توزین حرارتی<sup>†</sup>(Shimadzu-449C) بررسی شد. آنالیز فازی تیتانیا با XRD (Jeol8000diffractometer) اندازهٔ انجام گرفت و سپس براساس رابطهٔ دبای شرر (رابطهٔ ۱) اندازهٔ

3. PVA.

4. Thermal Gravimetric Analysis.

١٦٥

OK

کریستالیت تیتانیا محاسبه شد. برای بررسی های مورفولوژی سطح و سطح مقطع لایه های ایجادشده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (PhillipsXL30) و (Cambridge S-360) استفاده شد.

$$B = \frac{0.9 \lambda}{t \cos \theta}$$
(1)

B دراین رابطه میزان پهن شدن پیک در نصف شدت ماکزیمم ناشیاز اثر اندازه کریستالیت (برحسب رادیان)، t قطر کریستالیت، λ طول موج پرتوی X بهکار رفته و θ زاویهٔ پراش است.

۳\_ نتیجه گیری

### **۱\_۳\_ زیرپایهٔ آلومینا**

برای ساخت زیرپایهٔ آلومینا از پودر KMS-92 استفاده شد؛ زیرا این پودر به صورت گرانوله و آماده برای پرس بود. به دلیل وجود افزودنی های مناسب در پودر و کاهش دمای زینترینگ زیرپایه با این افزودنی ها، به کارگیری این پودر امکان ساخت زیرپایه در دماهای زینترینگ پایین تر و همچنین ساخت زیرپایهٔ متخلخل را فراهم کرد. لازم به ذکر است که یک زیرپایهٔ مطلوب بایستی علاوه بر تأمین پایداری مکانیکی لایه یا زیرپایهٔ مطلوب بایستی علاوه بر تأمین پایداری مکانیکی لایه یا را فراهم سازد [۵]. حصول این موارد با به کارگیری پودر دافراهم سازد [۵]. حصول این موارد با به کارگیری پودر دافراهم سازد [۵]. محمول این موارد با به کارگیری پودر بهمدت ۱ ساعت در ۲°۵۰ را نشان می دهد.

همان طور که در منحنی میزان تخلخل زیرپایه ها برحسب دمای زینترینگ (شکل۲) مشاهده می شود، تا دمای C°۱۳۰۰ تقریباً میزان تخلخل ثابت و درحدود ۵۰٪ است. از دمای C۲۲۵۵C کاهش در میزان تخلخل زیرپایه ها آغاز می شود.



16.00

18.00



شکل ۲. منحنی تغییرات تخلخل زیرپایه ها برحسب دمای زینترینگ.



داده های مربوط به استحکام زیرپایه ها در شکل ۳ آمده است. همان طور که مشاهده می شود با افزایش دمای زینترینگ زیرپایه ها، استحکام آنها افزایش می یابد.

یکی از عوامل مهم در تعیین راندمان و کارایی یک غشا، نفوذيذيري أن است [٥]. از أنجابي كه نفوذيذيري غشا نيز خود به میزان تخلخل های زیریایه وابسته است، دمای زینترینگ زیرپایه باید به گونه ای انتخاب شود که درنهایت نفوذپذیری غشا در حد مطلوب و بهینهٔ خود قرار گیرد. ازطرف دیگر در انتخاب دمای زینترینگ، به استحکام زیرپایه نیز باید شود؛ بهروشی که غشای ساخته شده درنهایت استحکام بالایی داشته باشد و بتواند فلاکس بالای مایع ورودی به غشا، جریان معکوس مایع برای شستوشوی غشا و موارد مشابه را درحین کار تحمل کند [۱]. درنتیجه یک زیرپایهٔ ایده آل، درعین داشتن نفوذپذیری بالا باید از استحکام مکانیکی بالایی نیز برخوردار باشد. با افزایش دمای زینترینگ، دو عامل مذکور در جهت عکس یکدیگر عمل می کنند؛ یعنی کاهش تخلخل های زیرپایه و سپس کاهش نفوذپذیری و ازطرفی دیگر افزایش استحکام ناشی از زینترینگ زیرپایه. از آنجایی که اختلاف در میزان تخلخل که عاملی تعیین کننده در نفوذپذیری غشاست در زیرپایه های زینترشده در دماهای ۱۳۲۵ و C°۱۳۵۰ اندک است و علاوه بر آن استحکام زیرپایهٔ زینتر شده در دمای C°۱۳۵۰ خیلی بیشتر از استحکام در دمای C°۱۳۲۵ است، در این تحقیق دمای زینترینگ زیرپایهها C°۱۳۵۰ انتخاب شد؛ یعنی دمایی که در آن میزان نفوذپذیری غشا و استحکام آن در محدوده ای یذیرفتنی باشد و برآیند این دو خاصیت بهینه شود.

#### ۲\_۲\_ سل کلوئیدی تیتانیا

همان طور که می دانید سل های کلوئیدی در فرآیند سل ژل، سوسپانسیون هایی بر پایهٔ آب هستند. روش متداول برای

ساخت سل کلوئیدی، به کارگیری مقادیر مازاد آب است (بالاتر از نسبت استوکیومتری لازم برای هیدرولیز کامل تیتانیا که برابر ۴ است) که به تولید سوسپانسیونی از ذرات نانومتری نسبتا درشت منجر خواهد شد. در این نوع سل واکنش اصلی برای کندانس، Olation است [۹،۵].

#### $M-OR+H_2O \rightarrow M-OH+R-OH$ Hydrolysis

M−OH+M−XOH→	
M-OH-M+X-OH	Olation
X=H or X=R	
$R=CnH_{2n+1}$ and $M=Si$ , $Ti$ , $Zr$ , $Al$	

انتخاب پیش ماده و حلال مصرفی در کیفیت سل و درنتیجه لایهٔ ساخته شده اهمیت بالایی دارد. پیش ماده های فلزی ازجمله ۲icl4 به شرایط ویژهٔ کاری نیاز دارند و سرعت هیدرولیز آنها به گونه ای است که کارکردن با آنها را مشکل می سازد، به همین علت در این تحقیق از تترا ایزوپروپیل اورتوتیتانات درنقش پیش ماده استفاده شد. حلال مصرفی ایزوپروپانول است؛ زیرا بهترین حلال، حلالی است که تعداد یکسانی اتم کربن در گروه آلکیل خود درمقایسه با آلکوکسید مصرفی داشته باشد [0].

در ساخت بهینهٔ سل کلوئیدی علاوه بر نوع پیش ماده و حلال مصرفی، عواملی چون pH سل، دمای لخته زدایی، زمان لختهزدایی، مقدار و نحوهٔ به کارگیری افزودنی های آلی نیز بسیار اهمیت دارد. شرایط سل کلوئیدی ساخته شده در جدول ۲ آمده است.

برای ساخت یک سل کلوئیدی بهینه، انجام مطلوب فرآیند لخته زدایی ضروری است. برای این منظور pH باید درمحدودهٔ ۰/۵ تا ۱/۵ باشد. عدم تنظیم pH در این محدوده مانع از انجام فرآیند لخته زدایی خواهد شد [٥]. در فرآیند لختهزدایی، آگلومرههای موجود دیسپرس می شوند و لایهای از

**جدول ۲**. شرایط ساخت سل کلوئیدی.

نوع سل	[H <sub>2</sub> O]/[Ti]	$[H^+]/[Ti]$	pН	دمای لختهزدایی (C°)
كلوئيدي	۲.	•/۵	١	۵۰

بار مثبت (<sup>+</sup>H) در اطراف هر ذره مجزا، (یا اطراف گروه کوچکی از ذرات)، تشکیل خواهد شد. با تنظیم pH، میزان نیروی دافعه ناشی از لایهٔ مضاعف الکتریکی ذرات سل به مقدار بهینهٔ خود می رسد. این امر سبب پایدارشدن سل خواهد مقدار بهینهٔ خود می رسد. این امر سبب پایدارشدن سل خواهد مقدار بهینهٔ خود می رسد. این امر سبب پایدارشدن سل خواهد مقدار بهینهٔ خود می رسد. این امر سبب پایدارشدن سل خواهد مقدار به ذکر است که pH سل با کاغذ pH مرک اندازه گیری شد.

فرآیند لخته زدایی پس از استفاده از حمام اولتراسونیک تکمیل خواهد شد. این امواج پرانرژی بقیهٔ آگلومره های نرم باقی مانده را شکسته و درنتیجه توزیع اندازهٔ ذرات سل باریک تر خواهد شد. ذرات ریزتر و توزیع یکنواخت آنها در سل کلوئیدی تیتانیا برای ساخت غشایی با خواص مطلوب ضروری است.

اندازهٔ ذرات سل های به کاررفته شده برای لایه نشانی، عاملی مهم و کلیدی در ایجاد غشایی بدون ترک و دارای حفرات با اندازه مشخص است. اندازهٔ ذرات سل پایدار تیتانیایی، تحت تأثیر غلظت یون هیدروژن یا همان pH سل است [۱۰]. همان طور که در شکل ۴ و جدول ۳ آمده است، اندازه گیری توزیع اندازهٔ ذرات سل پس از پایدارسازی، نشان داد که اندازهٔ میانگین ذرات سل کلوئیدی ۵۵/۶ نانومتر است.

مرحلهٔ خشک کردن یکی از مهم ترین و بحرانی ترین مراحل در ساخت غشاهای سرامیکی است؛ زیرا در این مرحله غشاها تمایل شدیدی به ترک خوردن نشان می دهند [۱۱].

درنتیجه فرآیند ساخت غشای دارای زیرپایه، همواره به ایجاد یک لایهٔ پیوسته و بدون ترک منجر نخواهد شد. بهطور خاص در غشاهای تیتانیایی، بخش زیادی از غشاهای دارای زیرپایه، پس از خشک کردن و کلسیناسیون، در لایهٔ فوقانی خود ترک خواهند داشت. ترک های ایجاد شده ناشی از تنش های بزرگی است که درحین مراحل خشک کردن و کلسیناسیون لایه ایجاد میشود. این تنش ها از استحکام شکست شبکهٔ ژل فراتر می روند و سبب ایجاد ترک می شوند. برای کاهش خطرات و مشکلات فرآیند به خصوص درحین مراحل خشک کردن و کلسیناسیون، قبل از لایه نشانی، باید از افزودنی های آلی استفاده کرد.

افزودنی های مصرفی در سل های کلوئیدی می توانند از تجمع ذرات جلوگیری کنند و ویسکوزیته سل را تنظیم کنند و همچنین با افزایش استحکام بدنهٔ خام از تشکیل ترک جلوگیری کنند [1۲]. درمورد غشاهای تیتانیایی بهترین نتایج از افزودن پلی وینیل الکل (PVA) در ترکیب با هیدروکسی پروپیل سلولز (HPC) حاصل می شود [۷]. در این تحقیق مشاهده شد که افزودن AVA به سل تیتانیا، در مقادیر بالاتر از ۱ تا ۲٪ وزنی تیتانیا به عدم پایداری و فلوکولاسیون سل منجر می شود. این امر ناشی از هم کنش بین تیتانیا و PVA است. در حضور HPC این واکنش رخ نمی دهد و پایداری سل تیتانیا کاهش نخواهد یافت. درنتیجه ابتدا باید محلول آبی HPC به سل اضافه شود و مسپس محلول آبی PVA اضافه شود. مکانیزم قطعی و دقیق سوختن و خارج شدن افزودنی های آلی به کار رفته در سل کلوئیدی، از دیگر مواردی است که بسیار اهمیت دارد. در شکل ۵ نتیجهٔ آنالیز توزین حرارتی برای لایهٔ کلوئیدی مشاهده می شود؛ همان طور که در شکل مشخص است، تا دمای ۱۳۰- ۲۵۰۰ آب کندانس شده در درون حفره ها و آب مختلفی را که وابسته به نقش این افزودنی هاست، زارزیچکی<sup>۵</sup> بررسی کرده است. مکانیزم ممکن می تواند مستحکم شدن شبکهٔ ژل ازطریق رشد گردنه باشد. احتمال دیگر می تواند حذف تنش های تجمعی باشد؛ تنش هایی که از ساختارهای نامتقارن و غیریکنواخت حفرها ناشی می شود [۵،۱۳].



.شکل۴. نمودار توزیع اندازهٔ ذرات سل کلوئیدی تیتانیا اندازه گیریشده با دستگاه زتاسایزر.

**جدول ۳.** نتایج اندازه گیری اندازهٔ ذرات سل کلوئیدی با دستگاه زتاسایزر.

نوع سل	(nm) اندازهٔ میانگین ذرات سل
كلوئيدي	۵۵/۶



5. Zarzicki.

جذب شده برروی سطح آنها تبخیر می شود. از دمای ۱۵۰ تا ۲°۴۰۰ کریستالیزاسیون 4(OH) به TiO رخ خواهد داد. تجزیه و خروج PVA و PPC نیز حدوداً از دمای ۲°۲۵۰ آغاز می شود و در دمای ۲°۴۰۰ به پایان می رسد [۱۳]. بنابراین کل کاهش وزن نمونه تا دمای ۲°۴۰۰ برابر ۳۰٪ وزن اولیه نمونه است و قبل از دمای نهایی کلسیناسیون اتفاق می افتد.

از عواملی که سبب خروج مواد پلیمری بدون ایجاد عیب در غشا می شود، نرخ گرمایش در مرحلهٔ کلسیناسیون است که کنترلکنندهٔ نرخ خروج مواد آلی از لایه می باشد. این نرخ باید به حد کافی پایین باشد تا غشای حاصل ترک نخورد. کنترل نرخ گرمایش علاوه بر اثر مذکور، از ایجاد ترک ناشی از عدم تطابق ضریب انبساط حرارتی لایه و زیرپایه مانع می شود.

### ۳\_۳\_ آنالیز فازی تیتانیای کلوئیدی

استحالهٔ پلی مورفیک تیتانیا پیچیده است که به دلیل وابستگی استحالهٔ مذکور به اندازهٔ کریستالیت، ناخالصیها، ترکیب شیمیایی و غیره می باشد [١٤]. درمورد رفتار حرارتی و محدودهٔ استحالهٔ فازی تیتانیا، گزارش های متعددی ارائه شده است. شکل ۶، آنالیز فازی پودرهای تهیهشده از سل کلوئیدی تیتانیا و عملیات حرارتی شده در دماهای مختلف را نشان می دهد.

همان طور که در الگوهای پراش اشعهٔ ایکس در شکل ۶ مشاهده می شود دمای استحالهٔ آناتاز به روتیل در تیتانیای کلوئیدی، حدود ۲°۵۵۰ است. آخرین مرحله تعیین کنندهٔ خواص غشا، کلسیناسیون آن است. این مرحله تعیین کنندهٔ خواص نهایی ریزساختاری، مکانیکی و شیمیایی است؛ لذا انتخاب دمای کلسیناسیون مناسب بسیار اهمیت دارد. برای انتخاب این دما عواملی از جمله استحالهٔ فازی تیتانیا و همچنین اندازهٔ کریستالیت در فاز آناتاز بسیار اهمیت دارد. تکنیک پراش اشعهٔ ایکس و نتایج حاصل از آن می تواند در انتخاب دمای بهینهٔ

مختلف در شکل ۶ نشان دهند، عدم وقوع استحالهٔ فازی آناتاز به روتیل تا دمای ۲°۵۰۰ است و درنتیجه، دمای کلسیناسیون لایه باید زیر ۲°۵۰۰ انتخاب شود تا از تشکیل فاز روتیل در روتیل هنوز رخ نداده است، رشد کریستالیتهای آناتاز اندک خواهد بود. در دماهای بالا، که استحالهٔ فازی مذکور رخ دهد، علاوه بر تحمیل ۸٪ تغییرات حجمی به سیستم، رشد شدید و سریع اندازهٔ کریستالیت رخ می دهد که به کاهش شدید سطح مخصوص و حجم حفره منجر خواهد شد. لازم به ذکر است که این مقدار تغییر حجم ناشی از استحالهٔ فازی تیتانیا، برای

دمای کلسیناسیون باید به نحوی انتخاب شود که علاوه بر خروج همهٔ مواد فرار از لایه و ایجاد ساختاری کاملاً کریستالی، از وقوع استحالهٔ فازی تیتانیا ممانعت شود و حداقل میزان اندازه کریستالیت و درنتیجه حداکثر میزان سطح مخصوص در غشای حاصل ایجاد گردد. تحت این شرایط دمای بهینهٔ کلسیناسیون ۲°۴۵۰ است. این دما حداقل دمایی است که در آن تیتانیا ساختاری کاملاً کریستالی دارد و مواد فرار لایه نیز به طور کامل خارج شده اند و تنها فاز موجود در لایه نیز آناتاز است.

بااستفاده از رابطهٔ ۱، اندازهٔ کریستالیت بااستفاده از پیک (۱۰۱) آناتاز (که بهمدت ۱ ساعت در دمای C°۴۵۰ زینتر شده) ۸/۳ نانومتر است.

## ۳-۴- تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از غشاهای کلوئیدی ساخته شده

یکی از عوامل بسیار مؤثر در کیفیت و ضخامت غشای تشکیل شده، غلظت سل کلوئیدی است. بررسی تصاویر میکروسکوپی نمونهها نشان داد که برای ساخت لایهٔ مطلوب و

بدون ترک، غلظت سل ساختهشده اهمیت زیادی دارد. شکل ۷ تصاویر مربوطبه لایهٔ ۳ کلوئیدی ساختهشده را نشان میدهد.

نتیجهٔ آنالیز EDS که از نمونه های شکل ۷ انجام گرفته است، در شکل ۸ آمدهاست. پیک شدید و بزرگ Ti مؤید لایهای از جنس تیتانیاست. پیک کلسیم مشاهده شده در آنالیز EDS

ناشیاز وجود کلسیم در زیرپایه است.

كنترل ضخامت لايه در غشاها بسيار اهميت دارد. ضخامت لایه تأثیر چشمگیری برروی نفوذپذیری غشا دارد؛ به نحوی که افزایش آن به کاهش نفوذپذیری منجر می شود. ضخامت لایه در غشای فوق حدود ۵۷۰ نانومتر است.



**شکل ۶.** آنالیز فازی پودر تیتانیای ساخته شده از سل کلوئیدی در دماهای ۶۰، ۴۵۰، ۵۵۰، ۶۰۰ و ۲°۸۰۰.



**(الف)** تصویر با بزرگنمایی کمتر



(ب) تصویر با بزرگنمایی بیشتر، ضخامت لایه درحدود ۵۷۰nm است

شکل۷. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی غشاهای حاصل از سلکلوئیدی.

خواهد خورد، (منظوراز مقدار بحرانی، حداکثر غلظت مجاز سل کلوئیدی است که پس از لایه نشانی، خشک کردن و کلسیناسیون لایه، ترکی در آن ایجاد نشود). در شکل ۹ سه بار لایه نشانی توسط سل کلوئیدی با غلظت بالاتر از حد بحرانی انجام شده است. به دلیل تنش های

باید گفت غلظت سل دارای بهینه دارد و برای افزایش آن محدودیت وجود دارد. هنگامی که غلظت سل از مقدار بحرانی خود بالاتر باشد، به دلیل افزایش بیش از حد ضخامت لایه و سپس افزایش تنش های ایجاد شده در آن درحین فرآیندهای خشک کردن و کلسیناسیون، لایهٔ حاصل ترک



شکل ۸ آنالیز EDS از لایهٔ کلوئیدی تیتانیا نشانده شده بر روی زیرپایهٔ آلومینا.





**(الف)** تصویر با بزرگنمایی کمتر

شکل ۹. ترکها در نمونه های سه بار لایه نشانی شده توسط سل کلوئیدی با غلظت بالاتر از حد بحرانی.

 "Application of Membrane Technologies for Liquid Radioactive Waste Processing", *International Atomic Energy Agency Vienna*, Technical Reports Series, No. 431 (2004)

مراجع

- 2. Methods of Water Purification, GE Infrastructure Water and Process Technology.
- Zaspalis, V. T., Praaq, W. V., Keizer, K., Ommen, J. G. V., Ross, J. and Burggraaf, A. J., "Reactor Studies using Vanadia Modified Titania and Alumina Catalytically Active Membranes for the Reduction of Nitrogen Oxide with Ammonia" *Journal Appl. Catal.*, Vol. 74 (1991) 249.
- Rahaman, M. N., "Ceramic Processing and Sintering", Second Edition, Marceldekker (2003).
- Sekulić-Kuzmanović, J., "Mesoporous and Micro porous Titania Membranes, Thesis", (2004) ISBN 90-365-2107-6.
- Yordanova, V., Stabova, K., Hintz, W., Tomas, J. and Wendt, U., "Exciter Laser Induced Photo-Thermal Changes of Sol-gel TiO<sub>2</sub> Thin Films", *Journal of Optoelectronics and Advanced Materials*, Vol. 7 No. 5 October (2005) 2601-2606
- 7. Hunter, J. R., "Zeta Potential in Colloid Science, Principles and Application", Academic Press, (1981).
- Li, W., Wang, S. M., Zhang, J. L. and Wang, B. G., "Synthesis of Titania Nan crystalline Film", School of Chemical Engineering, Tianjin 300072 China.
- Gestel, T. V., Vandecasteele, C., Buekenhoudt, A., Dotremont, C., Luyten, J., Leysen, R., Bruggen, B. V. D. and Maes, G., "Alumina and Titania Multilayer Membranes for Nan Filtration, Presentation, Characterization and Chemical Stability", *Journal Membrane Science*, Vol. 207 (2002) 73-89.
- Olphen, H. V., "An Introduction to Clay Colloid Chemistry, for Clay Technologists, Geologists, and Soil Scientists", John Wiley and Sons (1977).
- Kumar, K. P., Zaspalis, V. T., Keizer, K. and Burggraaf, A. J., "Drying Process in the Formation of Sol-Gel-Derived TiO<sub>2</sub> Ceramic Membrane", *Journal Non-Crystalline Solids*, Vol. 147-148 (1992) 375-381.
- Larbot, A., Fabre, J. P., Guizard, C. and Cot, L., "Inorganic Membrane Obtained by Sol-Gel Techniques", *Journal Membrane Science*, Vol. 39 (1988) 203-212.
- Zaspalis, V. T., Van Praag, W., Keizer, K., Ross, J. R. H. and Burggraaf, A. J., "Synthesis and Characterization of Primary Alumina, Titania and Binary Membranes", *Journal Materials Science and Catalysis* (1992) 1023-1035.
- Schneider, M. and Baiker, A., "Aero Gels in Catalysis, Catalysis Reviews", *Science and Engineering*, Vol. 37 (1995) 515-556.
- 15. Fan, Q., Mcquillin, B., Ray, A. K., Turner, M. L. and Seddon, A. B., "High Density, Non-Porous Anatase

زیاد ایجادشده در مراحل خشک کردن و زینترینگ لایه که ناشیاز ضخامت زیاد آن است، نمونهها ترک دارند.

مهم ترین عوامل ایجاد ترک در لایه، استحالهٔ فازی آناتاز به روتیل و همچنین مقدار زیاد تنش ایجادشده در مرحلهٔ کلسیناسیون است. به دلیل انتخاب مناسب دمای زینتر در نمونه های فوق و ممانعت از وقوع استحالهٔ فازی مذکور (مطابق با نتایج آنالیزهای فازی انجام شده) عامل اصلی تشکیل ترک در نمونه های فوق، تنش های بزرگ ایجاد شده در مرحله کلسیناسیون و ناشی از ضخامت زیاد لایه است. درصورت کاهش ضخامت لایه به مقدار بهینهٔ خود، کاهش نرخ گرمایش در مرحلهٔ کلسیناسیون و به کارگیری افزودنی های آلی، امکان حذف این تنش ها و ساخت لایه ای بدون ترک ممکن می شود. گرمایش سریع از دو راه می تواند تنش را در لایه افزایش دهد؛ افزایش تنش ناشی از افزایش سرعت خروج مواد فرار لایه و زیریایه [۵۰].

## ۴\_ نتیجه گیری

در این تحقیق غشای بدون ترک تیتانیا به طور مطلوبی برروی زیرپایهٔ آلومینا نشانده شد و شرایط بهینهٔ ساخت بررسی شد. سل کلوئیدی ساخته شده پس از پایدارسازی ۵۵/۶ نانومتر بود. برای تثبیت کامل لایه، دمای زینترینگ آن C°۴۵ انتخاب شد.

در این دما همهٔ مواد فرار لایه خارج شدهاند و استحالهٔ فازی آناتاز به روتیل هنوز رخ نداده است. ضخامت لایه در غشای فوق حدود ۵۷۰ نانومتر است که سبب افزایش نفوذپذیری غشا خواهد شد. Appl. Phys., Vol. 33 (2000) 2683-2686.

Titania Thin Films for Device Applications", Journal